

薄膜作製装置

芝浦メカトロニクス株式会社製

設置場所： バイオナノテクノロジーセンター（片柳研究所棟 6階）



超微細加工技術を施したマイクロ／ナノスケールのバイオチップなどの作製に用いられます。各種のバイオチップやバイオセンサーの開発や疾病の早期発見を目的とした遺伝子診断チップの開発へ応用。

装置の特長

- 3つのスパッタ源を備え、広範囲に渡り均一な膜厚分布
- 高周波電源（500W）整合器標準装備
- ターボポンプを採用し、装置の立ち上げ時間を短縮

主な仕様

- Sputter method Magnetron side-sputter
- Sputter source Model P-GUN75 (Φ3 inch) × 3
- Jig (Select) Φ200mm heated roundtable for reverse sputter
Φ200mm cooled roundtable for reverse sputter
- Ultimate pressure (c) 5×10^{-4} Pa ● Exhausting time 7×10^3 Pa (10min)
- Power Supply RF (500W)